

# 産業技術総合研究所 先端機器共用イノベーションプラットフォーム (IBEC-IP)

産業技術総合研究所  
つくばイノベーションアリーナ推進部  
IBECセンター

# TIA-nano ナノテク共用施設

## 高エネルギー加速器研究機構

- 放射光科学研究施設  
(フォトンファクトリー；PF) ●

## 物質・材料研究機構

- 低炭素化材料設計・創成ハブ拠点 ●
- ナノテクノロジープラットフォーム ●  
(微細構造解析/微細加工/分子・物質合成)

## 筑波大学

- ナノサイエンスプロジェクト共用装置
- ナノ・バイオ融合教育研究システム ●
- マルチタンデム加速器施設 ●

## 産業技術総合研究所

- 先端ナノ計測施設 ●
- 電子顕微鏡施設
- 高分解能NMR施設
- 脳機能計測評価施設
- MEMSファウンダリ
- ナノプロセッシング施設 ●
- 機能性酸化物ナノテクノロジー研究拠点 ●



- 文部科学省 「先端研究施設共用促進事業」に参画
- 文部科学省 「ナノテクノロジープラットフォーム」に参画
- 文部科学省 「低炭素研究ネットワーク」に参画

# 先端機器共用イノベーションプラットフォーム (IBEC-IP)



ICT / **B**iototechnology / **E**nergy & Environmental Tech.  
Converging Tech.

## 産総研先端機器・施設群の公開による オープンイノベーション推進・人材育成

### 計測・分析施設

- ・ 先端ナノ計測施設 (ANCF)
- ・ 電子顕微鏡施設 (TEM/SEM)
- ・ 高分解能NMR施設 (HRNMR)
- ・ 脳機能計測評価施設 (BIT)

### 微細加工施設

- ・ MEMSファウンダリ (MEMS)
- ・ ナノプロセッシング施設 (NPF)
- ・ 機能性酸化物グリーン  
ナノテクノロジー拠点 (GreFON)

## ● 先端ナノ計測施設 (ANCF)

産総研独自開発による20台の最先端計測機器群

- 軽元素のXAFS測定 (S-XAFS)
- 欠陥イメージング  
(陽電子欠陥測定装置)
- 巨大分子質量測定  
(超伝導検出器質量分析装置)
- 物性測定 (ナノ・ピコ秒分光装置)



S-XAFS  
(KEK-PFに設置)



超伝導検出器  
質量分析装置

## ● 電子顕微鏡施設 (TEM/SEM)

無機系からバイオ系までの広範囲な材料に対応できる10台の電子顕微鏡群

- 微細構造観察/元素分析 (EELS, EDX)
- STEM測定
- HAADF-STEM測定
- トモグラフィー測定
- クライオTEM測定



TEM (EM-002B)

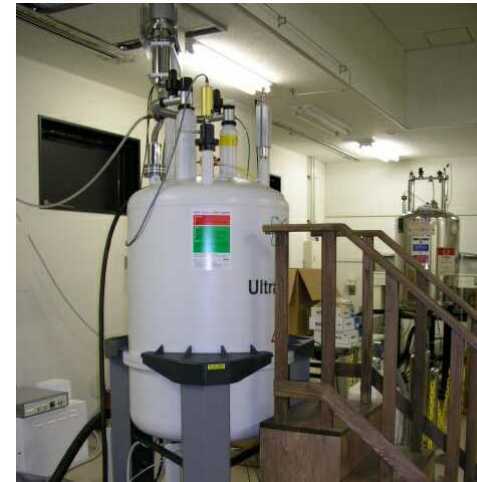


SEM (S-5000)

## ● 高分解能NMR施設 (HRNMR)

種々の最新測定法 / シンプル・短時間  
測定が可能な500MHz NMR装置群

- ・タンパク質立体構造解析
- ・有機化合物解析
- ・有機合成における反応中間体の同定  
など、各種溶液NMR測定



適応核種  
 $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ,  $^{15}\text{N}$



適応核種  
 $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ,  $^{19}\text{F}$ ,  $^{29}\text{Si}$

## ● 脳機能計測評価施設 (BIT)

ヒト, 動物を対象とした3テスラMRI装置

- ・脳機能(血流)計測 (脳機能解明)
- ・脳機能計測による製品やサービスの評価  
(ニューロマーケティング等への応用)
- ・解剖学的知見



3テスラ MRI装置



## ● MEMSファウンドリ施設 (MEMS)

**MEMS関連微細形状成形・評価に用いる  
8台の装置**

- ・熱インプリント装置
- ・光学計測機器(Zygo)
- ・ステッパ
- ・FIB 等



熱インプリント装置  
(1,400℃対応)



Zygo

## ● ナノプロセッシング施設 (NPF)

**先端材料・デバイスの微細加工から機能検証  
まで一貫して行える50台の研究開発装置群**

- ・電子ビーム描画装置
- ・スパッタ成膜装置
- ・反応性イオンエッチング装置 等



電子ビーム  
描画装置

## ● 機能性酸化物グリーンナノテクノロジー 拠点 (GreFON)

**機能性酸化物を主対象としたナノグリーン  
分野の実用化研究を可能とする7台の装置群**

- ・酸化物薄膜エッチング装置
- ・マスクレス露光装置
- ・ECRスパッタ装置 等



酸化物薄膜  
エッチング装置

# IBEC-IPのご利用申請方法など について

## ibec 先端機器共用イノベーションプラットフォームとは

独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)では様々な研究開発が行われており、その実験機器・設備は基盤技術から先端技術まで幅広い研究分野と領域にわたるものとなっています。産総研は、これらの機器・設備を社会と共有することで、産総研内外のノウハウを必要に応じて有機的に連携させるとともに、異分野融合の促進、新規研究分野への参入障壁の低減、研究開発支援や技術移転によるソリューションの提供、そして、開かれた場であるからこそ可能となる人材の育成を通じて、協創の場としてのオープン・イノベーション・プラットフォームのご提供を目指しています。それが、先端機器共用“IBEC”イノベーションプラットフォームです。このイノベーションプラットフォームは、皆様のご参加によって活性化します。是非、ご利用ください。

他の研究機関と協力して、施設を横断的に使用したサービスもご提供します。 ※ [お申し込み方法](#)  
Web上にバーチャルな意見交換広場がございます。 ※ [意見交換広場](#)

### 協力機関 Webサイト

- ※ [イノベーションつくば / つくばにおける共用施設ネットワーク](#)
- ※ [東京都立産業技術研究センター / 東京都ナノテクノロジーセンター](#)
- ※ [Center for Integrated Nanotechnologies \(CINT\)](#)

## >>>施設復興状況

### IBECからのお知らせ

- |               |      |                                                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------|
| 2012/09/24(月) | お知らせ | 【GreFON】酸化物エレクトロニクススクール開催のご案内 (H24/10/29・10/30)      |
| 2012/09/21(金) | お知らせ | 【開催案内 10/19(金)】放射光施設連携産業利用報告会                        |
| 2012/09/10(月) | お知らせ | 【開催案内 10/9(火)】TIA-nano参画4機関の共用機器・施設利用説明会             |
| 2012/09/03(月) | お知らせ | 【募集開始】H24年度人材育成スクール                                  |
| 2012/08/21(火) | お知らせ | 【課題募集】フォトンファクトリーの産業利用@KEK-PF(※切:平成24年10月15日(月)17:00) |

[過去のお知らせ一覧](#)

### ログイン Login

会員番号

パスワード

※ [パスワードをお忘れの方](#)

ログイン

トップページ

マイページ

会員登録

IBEC 図書館

ご提供サービス

お申し込み方法

装置予約の方法

装置・施設の紹介

成果利用について

Q&A

リンク集

相談窓口・アクセス



[課金係数についてのお知らせ](#)

[装置予約状況一覧ページへ](#)

## 施設・装置リスト

### 利用可能な加工、計測、分析、及び、評価装置のリスト

施設：  装置種別：

#### 先端ナノ計測施設(ANCF)

| 装置名                                            |
|------------------------------------------------|
| <a href="#">超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置</a>            |
| <a href="#">陽電子欠陥測定装置</a>                      |
| <a href="#">超伝導検出器搭載イオン価数弁別MALDI TOF質量分析装置</a> |
| <a href="#">超伝導検出器搭載イオン価数弁別ESI TOF質量分析装置</a>   |
| <a href="#">超伝導検出器搭載SSLD MALDI TOF質量分析装置</a>   |
| <a href="#">超伝導検出器搭載イオン価数弁別二重収束質量分析装置</a>      |
| <a href="#">フォトリソグラフィー関連設備</a>                 |
| <a href="#">ジョセフソン接合作製装置</a>                   |
| <a href="#">反応性イオンエッチング</a>                    |
| <a href="#">触芯式段差計 αステップ</a>                   |
| <a href="#">表面プローブ顕微鏡1</a>                     |
| <a href="#">ナノ秒可視・近赤外蛍光寿命計測装置</a>              |

▶ [トップページ](#)

▶ [マイページ](#)

▶ [会員登録](#)

▶ [IBEC 図書館](#)

▶ [ご提供サービス](#)

▶ [お申し込み方法](#)

▶ [装置予約の方法](#)

▶ [装置・施設の紹介](#)

▶ [成果利用について](#)

▶ [Q&A](#)

▶ [リンク集](#)

▶ [相談窓口・アクセス](#)

## 超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置



|       |                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置                                                                                                                                                                         |
| メーカー  | 独自開発                                                                                                                                                                                        |
| 課金額   | 12005/時間<br>※課金係数1でご利用の場合                                                                                                                                                                   |
| 導入年月日 | 2011/07/01(金)                                                                                                                                                                               |
| 仕様    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蛍光X線エネルギー分解能: 10 eV</li> <li>・ エネルギー範囲: 100 eV - 15 keV (1 keV以下は超伝導、以上は半導体)</li> <li>・ 光子計数率: 1 Mcps</li> <li>・ 液体ヘリウムを使用せず自動冷却(0.3 K)</li> </ul> |
| 備考    |                                                                                                                                                                                             |

### 装置詳細情報

- ✓ 装置名称
- ✓ 装置写真
- ✓ メーカー
- ✓ 課金額
- ✓ 導入年月日
- ✓ 仕様
- ✓ 備考

▶ トップページ

▶ マイページ

▶ 会員登録

▶ IBEC 図書館

ビス

方法

方法

の紹介

について

アクセス

# (割引)課金係数について

## (2012年10月9日現在)

下記施設の平成24年度(2012年度)のご利用につきましては、ユーザー様のご所属により、課金額に(割引)係数が掛かります。

- 先端ナノ計測施設 (ANCF)
- 電子顕微鏡施設 (TEM/SEM)
- 高分解能NMR施設 (HRNMR)
- 脳機能計測評価施設 (BIT)
- MEMSファウンドリ (MEMS)

- ◆ 中小企業(中小企業支援法第2条) “係数” = 0.5
- ◆ 大学・高専等教育機関関係者 “係数” = 0.5
- ◆ 産総研「連携千社の会」の会員法人は、  
「H24年4月1日以降の最初の利用」についてののみ “係数” = 0
- ◆ その他 “係数” = 1

<http://open-innovation.jp/ibec/device/#info>

## 1. 技術相談サービス

皆様がお持ちの疑問点・問題点を解決するための道筋を、皆様とともに考えます。

## 2. 装置利用サービス

産総研の先端機器をご利用いただけます。

## 3. 技術支援サービス

皆様からご相談を受けました問題点や課題を、皆様に代わって試作・分析したり、共同で解決するサービスです。

## 4. 成果育成支援サービス

IBEC-IP で得られた成果を、学術論文、特許出願、ベンチャー設立などに結実させるお手伝いをいたします。

## 5. 実施訓練サービス

装置利用時のみならず、ご希望に応じて装置利用のガイダンスをいたします。

## 6. 人材育成サービス

短期要素技術習得スクールから長期の製造技術習得スクールまで、様々なカリキュラムをご提供しています。

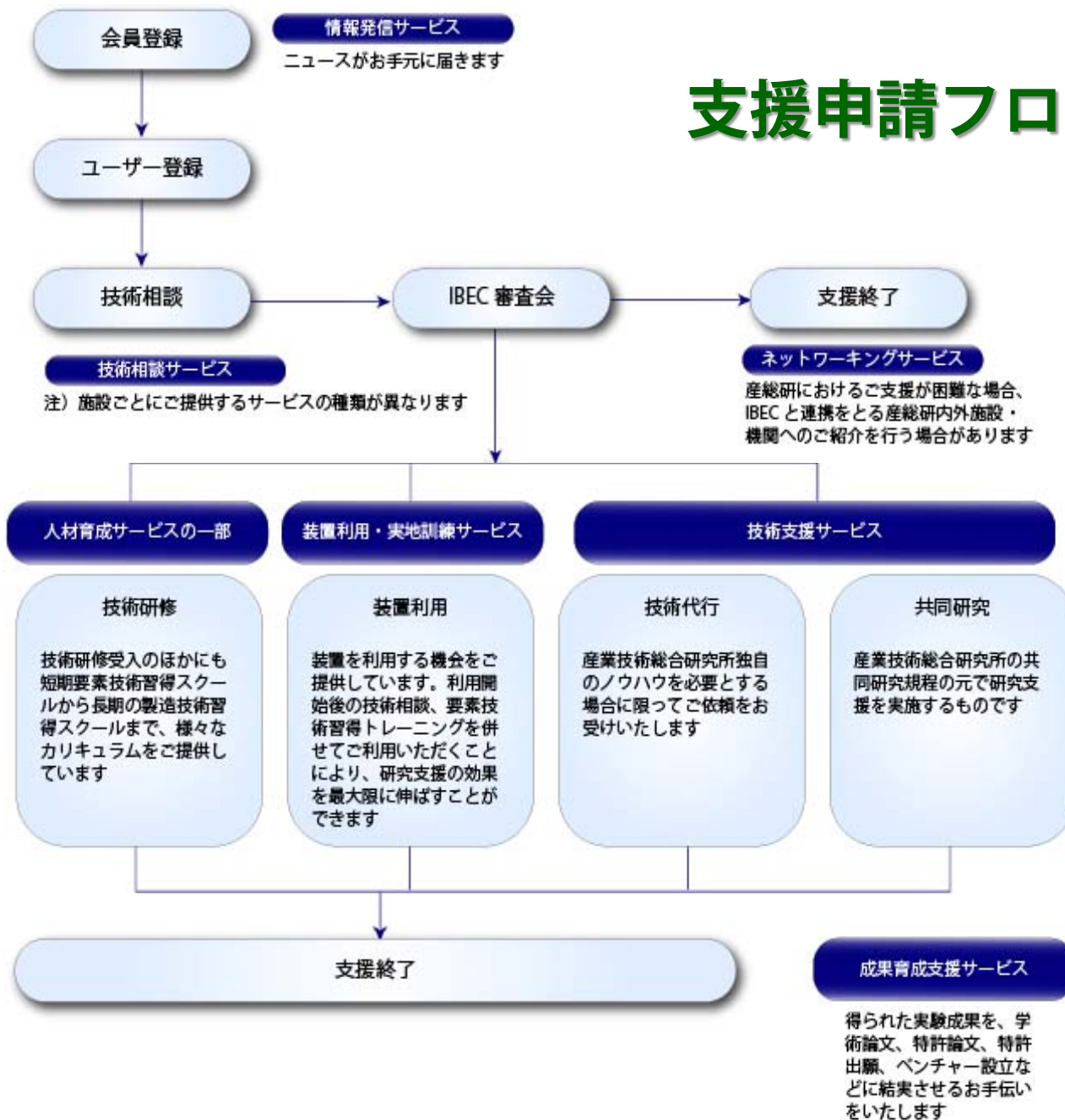
## 7. 情報発信サービス

IBEC-IP で開発されたノウハウや、最新の科学技術情報などをお手元にお送りいたします。

## 8. ネットワーキングサービス

IBEC-IP において、産総研内外の関係各機関との連携機会をご提供いたします。

# 支援申請フロー





## ibec 先端機器共用イノベーションプラットフォームとは

独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)では様々な研究開発が行われており、その実験機器・設備は基盤技術から先端技術まで幅広い研究分野と領域にわたるものとなっています。産総研は、これらの機器・設備を社会と共有することで、産総研内外のノウハウを必要に応じて有機的に連携させるとともに、異分野融合の促進、新規研究分野への参入障壁の低減、研究開発支援や技術移転によるソリューションの提供、そして、開かれた場であるからこそ可能となる人材の育成を通じて、協創の場としてのオープン・イノベーション・プラットフォームのご提供を目指しています。それが、先端機器共用“IBEC”イノベーションプラットフォームです。このイノベーションプラットフォームは、皆様のご参加によって活性化します。是非、ご利用ください。

他の研究機関と協力して、施設を横断的に使用したサービスもご提供します。 [※お申し込み方法](#)  
Web上にバーチャルな意見交換広場がございます。 [※意見交換広場](#)

### 協力機関 Webサイト

- ※ [イノベーションつくば / つくばにおける共用施設ネットワーク](#)
- ※ [東京都立産業技術研究センター / 東京都ナノテクノロジーセンター](#)
- ※ [Center for Integrated Nanotechnologies \(CINT\)](#)

## >>>施設復興状況

## まずは「会員登録」

### IBECからのお知らせ

- |               |      |                                                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------|
| 2012/09/24(月) | お知らせ | 【GreFON】酸化物エレクトロニクススクール開催のご案内 (H24/10/29・10/30)      |
| 2012/09/21(金) | お知らせ | 【開催案内 10/19(金)】放射光施設連携産業利用報告会                        |
| 2012/09/10(月) | お知らせ | 【開催案内 10/9(火)】TIA-nano参画4機関の共用機器・施設利用説明会             |
| 2012/09/03(月) | お知らせ | 【募集開始】H24年度人材育成スクール                                  |
| 2012/08/21(火) | お知らせ | 【課題募集】フォトンファクトリーの産業利用@KEK-PF(※切:平成24年10月15日(月)17:00) |

[過去のお知らせ一覧](#)

### ログイン Login

会員番号

パスワード

[※パスワードをお忘れの方](#)

ログイン

トップページ

マイページ

会員登録

IBEC 図書館

ご提供サービス

お申し込み方法

装置予約の方法

装置・施設の紹介

成果利用について

Q&A

リンク集

相談窓口・アクセス

## 会員登録

トップページ ▶ 会員登録

### IBEC 会員登録申請

産業技術総合研究所職員以外の一般の方が会員登録を行う場合は、

- ※ [会員登録フォーム](#)から登録を行ってください。

### 産業技術総合研究所：職員向け会員登録申請

職員がIBEC会員登録申請を行う場合は

- ※ [職員向け会員登録フォーム](#)からご登録をお願いします。

※ PAGE TOP

▶ トップページ

▶ マイページ

▶ 会員登録

▶ IBEC 図書館

▶ ご提供サービス

▶ お申し込み方法

▶ 装置予約の方法

▶ 装置・施設の紹介

▶ 成果利用について

▶ Q&A

▶ リンク集

▶ 相談窓口・アクセス

## 会員登録

トップページ・会員登録

### 先端機器共用イノベーションプラットフォーム会員(IBEC会員)募集中

ご登録いただいた皆様には、IBEC各施設で開催される人材育成スクールの情報を随時お送りするほか、ナノテクノロジー、ナノエレクトロニクス、情報通信、MEMS、フォトニクス、環境・エネルギー、バイオテクノロジーなど多彩な研究分野における最新の情報や、学協会・産業界の動向や、研究開発のお役に立つニュースをお伝えしていきます。(登録は無料です)

**必須** がついている項目は必ず入力してください

注意：30分以上同じ画面のままでいますとログアウトされますのでご注意ください。

#### 登録情報

✓ 氏名

✓ メールアドレス

|           |         |                                                                                                                     |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>必須</b> | 氏名      | (姓) <input type="text"/> (名) <input type="text"/>                                                                   |
| <b>必須</b> | 氏名 (かな) | (姓) <input type="text"/> (名) <input type="text"/>                                                                   |
| <b>必須</b> | メールアドレス | (例) aaa@aaaaa.aa.jp<br><input type="text"/> <半角英数字><br>※確認のためメールアドレスは2回同じものをご入力下さい。<br><input type="text"/> <半角英数字> |
|           | 生年月     | ユーザーにご登録いただいたのち、パスワード再発行が必要になった際に、この生年月をお尋ねします。<br><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月                    |
|           | ご意見・ご希望 | <input type="text"/>                                                                                                |

確認ページへ

「会員番号」と「仮パスワード」を  
自動配信メールにてお知らせします

トップページ

マイページ

会員登録

IBEC 図書館

ご提供サービス

お申し込み方法

装置予約の方法

装置・施設の紹介

成果利用について

Q&A

リンク集

相談窓口・アクセス

## ibec 先端機器共用イノベーションプラットフォームとは

独立行政法人 産業技術総合研究所 (産総研)では様々な研究開発が行われており、その実験機器・設備は基盤技術から先端技術まで幅広い研究分野と領域にわたるものとなっています。産総研は、これらの機器・設備を社会と共有することで、産総研内外のノウハウを必要に応じて有機的に連携させるとともに、異分野融合の促進、新規研究分野への参入障壁の低減、研究開発支援や技術移転によるソリューションの提供、そして、開かれた場であるからこそ可能となる人材の育成を通じて、協創の場としてのオープン・イノベーションを目指しています。それが、先端機器共用“IBEC”イノベーションプラットフォームは、皆様のご参加によって活性化します。是非、ご利用ください。他の研究機関と協力して、施設を横断的に使用したサービスもご提供いたします。Web上にバーチャルな意見交換広場がございます。 ※意見交換広場

### 協力機関 Webサイト

- ※ イノベーションつくば / つくば における共用施設ネットワーク
- ※ 東京都立産業技術研究センター / 東京都ナノテクノロジーセンター
- ※ Center for Integrated Nanotechnologies (CINT)

「マイページ」へ  
ログイン

ログイン  
Login

会員番号

パスワード

※パスワードをお忘れの方

ログイン

## >>>施設復興状況

### IBECからのお知らせ

- |               |      |                                                 |
|---------------|------|-------------------------------------------------|
| 2012/09/24(月) | お知らせ | 【GreFON】酸化物エレクトロニクススクール開催のご案内 (H24/10/29・10/30) |
| 2012/09/21(金) | お知らせ | 【開催案内 10/19(金)】放射光施設連携産業利用報告会                   |
| 2012/09/10(月) | お知らせ | 【開催案内 10/9(火)】TIA-nano参画4機関の共用機器・施設利用説明会        |

トップページ

マイページ

会員登録

IBEC 図書館

ご提供サービス

お申し込み方法

装置予約の方法

装置・施設の紹介



### ● マイページ

マイページ : トップ

ようこそマイページへ

※ PAGE TOP

ようこそ 様

※ログアウト

マイページトップ

登録情報

支援申請

装置予約

進捗状況

課金状況

退会手続き

次に「支援申請」



## ● 支援申請

### 申請種別

- ✓ 装置利用
- ✓ 技術代行
- ✓ 技術相談
- ・・・など

### 利用希望施設

- ✓ 先端ナノ計測施設 (ANCF)
- ✓ 脳機能計測評価施設 (BIT)
- ・・・など

**必須** がついている項目は必ず入力してください。

注意：30分以上同じ画面のままでいますと、システムとの接続が切断され、強制的にログアウトされますのでご注意ください。

[マイページ](#) > 支援申請

※[ログアウト](#)

マイページトップ

登録情報

支援申請

装置予約

進捗状況

課金状況

退会手続き

|           |          |            |
|-----------|----------|------------|
| <b>必須</b> | 申請種別     | ---        |
| <b>必須</b> | 利用希望施設   | ---        |
| <b>必須</b> | 課題名      | <b>課題名</b> |
| <b>必須</b> | 課題名の開示可否 | 許可         |

[次のページへ](#)

※ [PAGE TOP](#)

**課題名の開示可否 「許可」 or 「拒否」**

特に文部科学省事業に参画している施設  
のご利用を希望される場合は重要

## 支援申請

**ご利用を希望される装置を選択  
(複数選択可)**

支援申請

以下のリストから利用希望装置を選択して

注意：30分以上同じ画面のままでいますと、システムとの接続が切断され、強制的にログアウトされますのでご注意ください。

ようこそ 様

※ログアウト

マイページトップ

登録情報

支援申請

装置予約

進捗状況

課金状況

退会手続き

先端ナノ計測施設(ANCF)

- ☐ 超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置
- ☐ 陽電子欠陥測定装置
- ☐ 超伝導検出器搭載イオン価数弁別MALDI TOF質量分析装置
- ☐ 超伝導検出器搭載イオン価数弁別ESI TOF質量分析装置
- ☐ 超伝導検出器搭載SSLD MALDI TOF質量分析装置
- ☐ 超伝導検出器搭載イオン価数弁別二重収束質量分析装置
- ☐ フォトリソグラフィー関連設備
- ☐ ジョセフソン接合作製装置
- ☐ 反応性イオンエッチング
- ☐ 触芯式段差計 αステップ
- ☐ 表面プローブ顕微鏡1
- ☐ ナノ秒可視・近赤外蛍光寿命計測装置
- ☐ ナノ秒可視・近赤外過渡吸収分光装置
- ☐ ピコ秒可視蛍光寿命計測装置
- ☐ ピコ秒可視・近赤外過渡吸収分光装置
- ☐ 固体NMR装置(1)
- ☐ 固体NMR装置(3)
- ☐ 固体NMR装置(4)
- ☐ 表面プローブ顕微鏡2と前処理装置
- ☐ マルチターゲットスパッタ装置

脳機能計測評価施設(BIT)

- ☐ 磁気共鳴画像装置(MRI装置)

- ☐ マスクレス露光装置(GreFON)
- ☐ エックス線光電子分光分析(XPS)装置

# 支援申請 ④

## ● 支援申請

マイページ > 支援申請

**必須** がついている項目は必ず入力してください。

注意：30分以上同じ画面のままでいますと、システムとの接続が切断され、強制的にログアウトされますのでご注意ください。

ようこそ 様

※ログアウト

マイページトップ

登録情報

支援申請

装置予約

進捗状況

課金状況

退会手続き

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参考資料              | PDFファイルを送付することができます。(1MB以下をお願いします)<br><input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/><br><input type="button" value="アップロード"/> |
| <b>必須</b> 研究・開発目標 | <b>研究・開発目標</b>                                                                                                                           |
| <b>必須</b> 希望支援内容  | <b>希望支援内容</b>                                                                                                                            |
| <b>必須</b> 支援終了条件  | <b>支援終了条件</b>                                                                                                                            |
| <b>必須</b> 秘密事項の取扱 | 覚書交換を希望 <input type="button" value="▼"/>                                                                                                 |
| <b>必須</b> 予想支援開始日 | ---- <input type="button" value="▼"/> 年 -- <input type="button" value="▼"/> 月                                                            |
| <b>必須</b> 予想支援終了日 | ---- <input type="button" value="▼"/> 年 -- <input type="button" value="▼"/> 月                                                            |
| キーワード             | <input type="text"/>                                                                                                                     |

### 秘密事項の取扱

- ✓ 秘密保持契約(NDA)を希望
- ✓ 覚書交換を希望
- ✓ 特段の取決は不要

支援開始年月／終了年月  
(予想、希望)

次のページへ

## ● 支援申請

**持込試料**  
「有」 or 「無」

**持込装置**  
「有」 or 「無」

**商品化の現状**  
(最も)当てはまるものを選択  
(複数選択可)

**論文発表の状況**

- ✓ 未定
- ✓ 論文出版済み
- ✓ 論文投稿中
- ✓ 論文準備中
- ✓ 論文発表の可能性がある
- ✓ 論文発表の予定はない

**発明の権利化状況**

- ✓ 未定
- ✓ 特許取得済み
- ✓ 特許出願中
- ✓ 特許出願予定
- ✓ 特許出願可能
- ✓ 公知の技術で特許性はない

**技術成果の公表の見込**

- ✓ 未定
- ✓ 全て成果報告書に記載する
- ✓ 必ずしも成果報告書に記載できないものもある
- ✓ 成果報告書には一切記載できない

特に文部科学省事業に参画している施設  
のご利用を希望される場合は重要

以下の内容で支援申請を行ってよろしいですか？

「申請する」ボタンを押すと申請が完了いたします。

|             |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申請種別        | 技術代行                                                                                                                                                            |
| 利用希望施設      | 先端ナノ計測施設(ANCF)                                                                                                                                                  |
| 課題名         | テスト                                                                                                                                                             |
| 課題名の開示可否    | 開示可                                                                                                                                                             |
| 研究・開発目標     | テスト                                                                                                                                                             |
| 希望支援内容      | テスト                                                                                                                                                             |
| 利用希望装置      | 超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置<br>陽電子欠陥測定装置<br>超伝導検出器搭載イオン価数弁別MALDI TOF質量分析装置<br>超伝導検出器搭載イオン価数弁別ESI TOF質量分析装置<br>超伝導検出器搭載SSLD MALDI TOF質量分析装置<br>超伝導検出器搭載イオン価数弁別二重収束質量分析装置 |
| 支援終了条件      | テスト                                                                                                                                                             |
| 秘密事項の取扱     | 覚書交換を希望                                                                                                                                                         |
| 予想支援期間      | 2012年10月～ 2013年03月                                                                                                                                              |
| キーワード       |                                                                                                                                                                 |
| 持込試料の有無     | 無                                                                                                                                                               |
| 持込装置の有無     | 無                                                                                                                                                               |
| 商品化の現状      | 商品化の見通しは今のところない                                                                                                                                                 |
| 発明の権利化状況    | 特許取得済み                                                                                                                                                          |
| 論文発表の状況     | 論文準備中                                                                                                                                                           |
| 技術成果の公表の見込み | 必ずしも成果報告書に記載できないものもある                                                                                                                                           |
| 参考資料        |                                                                                                                                                                 |

▶ マイページトップ

▶ 登録情報

▶ 支援申請

▶ 装置予約

▶ 進捗状況

▶ 課金状況

▶ 退会手続き

**「IBEC SYSTEM：IBEC 支援申請を  
受け付けました」  
というタイトルのメールが  
自動配信されます**

修正する

申請する



## 支援申請受理後・・・

### 1. 各施設の担当者から下記事項をご連絡 (メール, 電話)

- 支援内容の確認
- 支援の可否
- 技術相談の日程調整 など

### 2. 技術相談 (課金方法, 諸手續に関するご説明も含む) (原則として、産総研にお出で頂くことになります)

### 3. 産総研にて技術支援させて頂く為の諸手續

- 「**技術研修**」制度に基づく受入が基本
- 支援内容によっては「**共同研究**」での実施

施設によって、手續に若干の違いがあります。  
詳細は、各施設の担当者にご確認下さい。

## ◆ IBEC-IPポータルサイト

<http://www.open-innovation.jp/ibec/>

## ◆ E-Mailでのお問い合わせ

[ibec\\_info-ml@aist.go.jp](mailto:ibec_info-ml@aist.go.jp)

## ◆ TEL/FAXでのお問い合わせ（施設によって番号が違います）

**TEL: 029-862-6592 / FAX: 029-849-1020**

先端ナノ計測施設 (ANCF)

電子顕微鏡施設 (TEM/SEM)

高分解能NMR施設 (HRNMR)

脳機能計測評価施設 (BIT)

MEMSファウンダリ (MEMS)

**TEL: 029-861-3210 / FAX: 029-861-3211**

ナノプロセッシング施設 (NPF)

機能性酸化物ナノテクノロジー研究拠点 (GreFON)